# การศึกษาการเกิด การเปลี่ยนระดับพลังงานในบ่อควอนตัมของสารกึ่งตัวนำ Er S-doped InP โดยวิธีโฟโตเคอเรนต์สเปกโตรสโคปี

Study of Interband Transition in Single Quantum well of Er  $\delta$ -doped InP

# by Photocurrent Spectroscopy

วิษณุ เพชรภา และ จิติ หนูแก้ว ห้องปฏิบัติการวิจัยควอนตัมและสารกึ่งตัวนำทางแสง ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาคกระบัง

ABSTRACT - This work is the observation of the interband transition energies of Er  $\delta$ -doped InP grown by Organometallic Vapor phase Epitaxy using Photocurrent Spectroscopy. The photocurrent spectra show the energy gap of ErP of 1.24 eV and three interband transition energies of InP/ErP single quantum well, 0.86 eV, 0.92 eV and 1.04 eV. The verification of these transition was made by developing a type-II single quantum well model to analyze the corresponding subband energy levels in conduction band and also the related transition energies. The results show good agreement to experimental data with acceptable band offset ratio.

**บทคัดย่อ** - งานวิจัยนี้เป็นการตรวจพบการเกิดการเปลี่ยนระดับพลังงานในบ่อควอนตัมของสารกึ่งตัวนำ Er δ-doped InP ที่ปลูกโดย กระบวนการ Organometallic Vapor Phase Epitaxy (OMVPE) สเปกตรัมของโฟโตเคอเรนต์ (Photocurrent) แสดงก่าพลังงานต้องห้ามของ ErP ที่ 1.24 eV นอกจากนั้นยังแสดงก่าพลังงานที่สอดกล้องกับการเปลี่ยนระดับพลังงานในบ่อควอนตัมระหว่าง InP และ ErP ซึ่งมีก่าดังนี้ 0.86 eV 0.92 eV และ 1.04 eV ในการตรวจสอบการเปลี่ยนระดับพลังงานดังกล่าว ได้สร้างแบบจำลองของบ่อศักย์ควอนตัมเดี่ยวแบบ Type-II ของ ErP/InP ขึ้น และกำนวณก่าระดับพลังงานย่อยในบ่อศักย์ของแถบนำ (Conduction Band) และสามารถนำไปกำนวณหาก่า พลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนได้พบว่า แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับผลการทดลองเป็น อย่างดี

กำสำคัญ - Photocurrent Spectroscopy, Er- doped InP, Type-II single quantum well

## บทนำ

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำในกลุ่ม III-V ได้รับความสนใจ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสารนี้เจือด้วยธาตุหายาก (Rare Earth) เช่น Erbium (Er) นอกจากนั้นวิธีการปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำที่ พัฒนาขึ้น เช่นวิธีการ Organomatallic Vapor Phase Epitaxy (OMVPE) ทำให้ได้สารกึ่งตัวนำโครงสร้างซับซ้อน (Heterostructure) ที่มีคุณภาพ สูง จากรายงาน [1] พบว่า เมื่อทำการเจือ Er<sup>3+</sup> ลงบน InP แบบบางมาก ( $\delta$ -doped) พบว่าเกิดสารประกอบ ErP (RE-V) ขึ้นที่มีโครงสร้างแบบ Rock Salt ที่มีค่า Lattice Constant a<sub>0</sub> = 0.5595 nm ค่าความหนาของชั้น ErP ที่ขึ้นอยู่กับเวลาในการเจือ Er (Exposure Time) สามารถวัดได้โดย กระบวนการ X-Ray Crystal Truncation Rod Scattering (X-Ray CTR) และ Rutherford Backscattering ในรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงการพบค่า พลังงานของการเปลี่ยนระดับพลังงานย่อย (Interband Transition Energy) ของ ErP ที่ได้จากการเจือ Er<sup>3+</sup> แบบบาง ( $\delta$ -doped) บน InP โดย วิธี OMVPE ซึ่งการตรวจพบทำได้โดยวิธีไฟโตเคอเรนต์สเปกโตรสโคปี (Photocurrent Spectroscopy) ในการกำนวณเพื่อหาค่าระดับพลังงานของ ชั้นย่อยในแถบการนำ (Conduction Band) และแถบวาเลนต์ (Valence Band) จะใช้แบบจำลองของบ่อ ควอนตัมแบบจำกัด Type-II (Type-II finite-quantum well) ระหว่าง InP และ ErP ที่มีค่า Energy Gap 1.35 eV และ 1.24 eV ตามลำดับ

## รายละเอียดการเตรียมสาร

ในการเตรียมสารกึ่งตัวนำ Er δ-doped InP โดยระบบ OMVPE แสดง โดยแผนผังดังรูปที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลักษณะการไหลของก๊าซทำ ในลักษณะขนานกับผิวของแผ่นรอง โดยใช้ Quartz Reactor ที่ความคัน 0.1 atm ก๊าซที่ใช้ประกอบด้วย

#### TMIn (Trimethylindium)

TBP (Tertiarybutylphosphine) แถะ

Er(MeCp)<sub>3</sub> (Tris(methylcyclopentadienyl)erbium) ที่เก็บไว้ที่ 100 °C

และใช้  $H_2$  เป็นตัวพาก๊าซทั้งสามเข้าสู่ Reactor ด้วยอัตรา 125 sccm อุณหภูมิของแผ่นรอง (Substrate) ควบคุมให้คงที่ที่ 530 C ซึ่งเป็น อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการจับตัวและเรียงตัวของชั้น ErP ที่ดีที่สุด อุณหภูมิที่ เปลี่ยนแปลงไปจากค่านี้ พบว่าจะทำให้จัดเรียงตัวของ ErP ไม่ดีพอ ชั้น InP ที่ไม่เจือ (Undoped InP Buffer Layer) หนา 100 nm เตรียมบน Fedoped InP (001) โดยปล่อย TBP และ TMIn เข้ามาใน Reactor พร้อมกัน หลังจากนั้นจะหยุดการไหลของ TMIn ก่อนการไหลของ Er(MeCp)<sub>3</sub> ประมาณ 30 วินาที เพื่อเป็นการล้างผิวหน้า การเจือแบบ  $\delta$ -doped โดย การไหล Er(MeCp)<sub>3</sub> ใช้ควบคุมความหนาของชั้น ErP ด้วยค่า Exposure time ตั้งแต่ 5-80 นาที หลังจากนั้นจะหยุดการไหลของ Er(MeCp)<sub>3</sub> ประมาณ 30 วินาที ก่อนจะปล่อย TMIn ใหลเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างชั้นของ Undoped- InP หนา 10 nm โดยการเตรียมสารตามขั้นตอนดังกล่าว จะ ได้สารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างดังรูปที่ 2



รูปที่ 1 แสดงแผนผังลำคับเวลาการ ใหลในการเตรียมสารกึ่งตัวนำ Er & doped InP โดย OMVPE



รูปที่ 2 แสดง โกรงสร้างของชั้น Heterostructure ของ Er  $\delta$ - doped InP

#### การทดลอง

ระบบ Photocurrent Spectroscopy (PC) ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยควอนตัม และสารกึ่งตัวนำทางแสงเป็นดังแผนผังในรูปที่ 3 แสงจากหลอดทังสเตน ที่ให้แสงความยาวกลื่นตั้งแต่ 300-2200 nm จัดตั้งให้ผ่านโมโนโกร มาเตอร์ (Monochromator) รุ่น SDMCI1-06 และตัวตัดแสง (Chopper) ที่ หมุนด้วยความถี่ 450 Hz และทำหน้าที่มอดูเลตแสง แสงจากโมโนโกร มาเตอร์ จะตกกระทบตัวอย่างสารกึ่งตัวนำ Er  $\delta$ -doped InP 2 ตัวอย่างที่มี ก่า Exposure Time ต่างกัน 2 ก่าคือ Exposure time 10 นาที และที่ Exposure time 80 นาที ซึ่งจะเปรียบสัญญาณนี้กับสารกึ่งตัวนำ InP ที่ไม่ เจือ (Undoped InP) สัญญาณกระแสจากตัวอย่างนำเข้าสู่ Lock-in Amplifier รุ่น SR510 ที่จะทำหน้าที่ขยายสัญญาณ ข้อมูลที่ได้คือค่าของ สัญญาณกระแสที่กวามยาวกลื่นแสงต่าง ๆ จะควบคุมและเก็บไว้โดย คอมพิวเตอร์



รูปที่ 3 แสดงระบบวัดโฟโตเกอเรนต์สเปกโตรสโกปี (Photocurrent Spectroscopy)

#### Technical Journal

100 Vol. III, No.11, July-October 2001



กราฟที่ 1 แสดงค่า Photocurrent ของ Undoped-InP และ Er  $\delta$ -doped InP ที่ Exposure time 80 นาที



กราฟที่ 2 แสดงสัญญาณ Photocurrent ของ Er  $\delta$ -doped InP ที่มี (a) Exposure time 10 นาที และ (b) 80 นาที

## ผลการทดลองและการวิเคราะห์

กราฟที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าของ Photocurrent ของ Undoped InP และ Er  $\delta$ -doped InP ที่ Exposure time 80 นาที ก่าพลังงานโฟตอนมีก่า ตั้งแต่ 0.8 eV ถึง 1.55 eV จากกราฟ สเปกตรัมที่ (1) ซึ่งตรวจพบในทั้ง สองตัวอย่างมีก่าพลังงานโฟตอน 1.37 eV แสดงถึงก่าพลังงานต้องห้าม (Energy Gap:  $E_p$ ) ของ InP สเปกตรัมที่ (2) ซึ่งตรงกับพลังงานโฟตอน 1.24 eV กวรเป็นสเปกตรัมที่แสดงถึงก่าพลังงานต้องห้ามของ ErP ใน Er  $\delta$ -doped InP เนื่องจากก่าดังกล่าวไม่เกิดขึ้นในตัวอย่างของ Undoped-InP และก่าพลังงานต้องห้ามของ ErP นี้ยังสอดกล้องกับผลการกำนวณในราย งานอื่น [1] สเปกตรัมที่ (3) (1.08eV) สเปกตรัมที่ 4 (0.94 eV) และ สเปกตรัมที่ 5 (0.87 eV) ซึ่งเกิดขึ้นในตัวอย่าง Er  $\delta$ -doped InP เท่านั้น ควรจะเกี่ยวข้องกับการเกิดการเปลี่ยนระดับพลังงานในบ่อควอนตัมของ ErP/InP ที่เป็นผลจากการเจือแบบบางด้วย Er

กราฟที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบของสัญญาณ photocurrent ของ Er  $\delta$ doped InP ที่ Exposure time 10 นาที (กราฟ a) และ 80 นาที (กราฟ b) โดยที่ก่าพถังงานโฟตอนมีก่าตั้งแต่ 0.8 eV ถึง 1.1 eV พบว่าทั้งสองตัว อย่างให้ก่า สเปกตรัมที่ 3 (1.08 eV) สเปกตรัมที่ 4 (0.94 eV) และ สเปกตรัมที่ 5 (0.87 eV) โดยที่ก่าลำคับสเปกตรัมเปรียบเทียบกับกราฟที่ 1 สเปกตรัมทั้งสามที่เกิดขึ้นในทั้งสองตัวอย่างแสดงถึงการเกิดการ เปลี่ยนระดับพลังงาน (Interband Transition) ในทั้งสองตัวอย่าง ซึ่งมีค่า พลังงานโฟตอนนี้ใกล้เคียงกัน ในทางทฤษฎีทางควอนตัมพอสรปได้ว่า ้ ค่ากวามกว้างของบ่อศักย์ที่หาได้จากกวามหนาของชั้น ErP นั้นมีค่าใกล้ เกียงกันสำหรับสองตัวอย่างนี้ แสดงว่าก่าความหนาของชั้น ErP (วัดที่ FWHM) นั้นเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเปลี่ยนค่า Exposure Time ซึ่งผล ดังกล่าวสอดคล้องกับผลที่ได้โดยวิธีการ X-Ray CTR ในงานวิจัยอื่น [2,3] นอกจากนั้นสัญญาณ photocurrent ของตัวอย่างที่มีค่า Exposure 80 นาที มีความคมชัดของสัญญาณมากกว่าตัวอย่างที่ Exposure 10 นาที แสดงว่าเวลาในการเจือ Er โดยกระบวนการ OMVPE นั้นมีผลต่อการจับ ตัวและจัดเรียงตัวของ ErP กล่าวคือเมื่อเวลาในการเจือนานขึ้น จะทำให้ การจับตัวระหว่าง Er กับ P และเกิดการจัดเรียงตัวของชั้น ErP ที่ดีขึ้น ซึ่ง สอดคล้องกับผลการตรวจสอบ โดย X-Ray CTR [2,3] ที่พบว่า ชั้นของ ErP จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเวลาในการเจือ Er นานกว่า 5 นาที การจัดเรียงตัว ของชั้น ErP ที่ดีกว่านี้ ยังผลให้เกิดโครงสร้างบ่อควอนตัมที่ดีกว่า และทำ ให้ใค้สัญญาณ Photocurrent ของการเปลี่ยนระดับพลังงานในบ่อควอน ตัมที่คมชัดกว่า

## แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาเป็นแบบจำลองอย่างง่ายเพื่อใช้ ในการคำนวณหาค่าพลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานในบ่อค วอนตัมของ ErP/InP ทั้งนี้ ค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในแบบจำลองนี้ได้จาก การทดลองและจากงานวิจัยอื่น [1-3] เนื่องจาก ErP ที่เจืออยู่บน InP มีค่า E ประมาณ 1.24 eV ขณะที่ InP มีค่า E เท่ากับ 1.35 eV ทำให้เกิดบ่อ ศักย์ควอนตัมที่จำกัด (Finite single quantum well) ขึ้น และเนื่องจากชั้น ของ ErP เกิดจากการเงือแบบบาง (δ-doping) จึงมีผลทำให้บ่อศักย์ ควอนตัมที่เกิดขึ้นควรมีลักษณะเป็นแบบ Type-II นอกจากนั้นจากผล การตรวจวัดค่าการกระจายของชั้น ErP โดยวิชีการ X-Ray CTR พบว่า ลักษณะของการกระจายของชั้นErP นั้นมีลักษณะคล้ายรูปด้วยู (Ushaped) ดังนั้นลักษณะของบ่อศักย์ที่เกิดขึ้นสามารถประมาณให้เป็นรูปสี่ เหลี่ยม (square well) ได้ ดังนั้นแบบจำลองบ่อศักย์ที่ใช้ในหาค่าพลังงาน ในการเปลี่ยนระดับพลังงานย่อย จะเป็นแบบ Type-II single finite square well ดังแสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 4 แสดงแบบจำลองบ่อศักย์ควอนตัมของ InP/ErP/InP

ค่าข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการกำนวณแสดงในตารางที่ 1 ความกว้างของ บ่อศักย์ของทั้งสองตัวอย่างนั้นได้จากการวิเคราะห์โดย X-ray CTR [2,3] มีก่าประมาณ 2.4 nm (8 ML) โดยวัดที่ Full width at Half Maximum ของสัญญาณที่ได้จาก X-ray CTR

ค่ามวลขังผล (Effective mass) ของ อิเล็กตรอน ( $m_e^*$ ) และ โฮล ( $m_h^*$ ) มี ค่าเป็น 1.71 $m_0$  และ 0.14 $m_0$  ตามลำดับ [1] ส่วนค่าความลึกของบ่อศักย์ สามารถคำนวณได้จากค่า Band offset ซึ่งโดยปกติสำหรับสารกึ่งตัวนำ โครงสร้างบ่อควอนตัมโดยทั่วไปค่า Band offset จะอยู่ในช่วง 60:40 ใน แบบจำลองนี้ค่า Band offset ที่ใช้มีค่าเป็น 56:44 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ ค่า Band offset ดังกล่าวจะให้ค่าความลึกบ่อศักย์ดังแสดงในรูปที่ 4 การ คำนวณหาค่าระดับพลังงานย่อย (subband) ในบ่อควอนตัม ทำได้โดย การแก้สมการชโรดิงเจอร์ใน 1 มิติ (Schrödinger Equation)

ตารางที่ 1 แสดงก่าข้อมูลของ ErP ที่ใช้ในการกำนวณ ก่า ระดับพลังงานย่อยในแถบการนำ

<sup>*</sup> e	1.71m <sub>0</sub>
Energy gap of ErP	1.24 eV
Well Width (2a)	2.4 nm (8 ML)
Band offset	56:44

Vol. III, No.11, July-October 2001

เมื่อพิจารณาบ่อศักย์ควอนตัมของแถบการนำ คังรูป



้ ค่าของศักย์ที่บริเวณต่าง ๆ คือ

V(x) = 0 x < -a บริเวณ (I) = -V -a < x < a บริเวณ (II) = 0 a < x บริเวณ (III)

สมการชโรคิงเจอร์ใน 1 มิติ เขียนได้เป็น

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m_e^*}{\eta^2}E\psi = 0 \qquad ..... (1)$$

สำหรับบริเวณ (I) and (III) และ

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m_e^*}{\eta^2} (E + V)\psi = 0 \qquad ..... (2)$$

สำหรับบริเวณ (II)

กำหนดให้

$$k^{2} = -\frac{2mE}{\eta^{2}}$$
 are  $q^{2} = \frac{2m(E+V)}{\eta^{2}}$ 

ี กำตอบของสมการ (1) และ (2) ซึ่งจะนำไปหาก่าระดับพลังงานย่อยใน บ่อศักย์ อยู่ในรูปของ k และ q ที่สอดกล้องกับสมการ

$$\frac{\kappa}{q} = \tan qa$$
 สำหรับ even parity ..... (3)

$$-\frac{\kappa}{q} = \cot qa$$
 สำหรับ odd parity ..... (4)

โดยที่

$$\frac{\mathbf{k}}{\mathbf{q}} = \left(\frac{-\mathsf{E}}{\mathsf{V} + \mathsf{E}}\right)^{\frac{1}{2}} \qquad \dots \tag{5}$$

$$\approx k^2 + q^2 = \frac{2m_e^*}{\eta^2}V$$
 ..... (6)

ดังนั้นก่าของระดับพลังงานย่อยในบ่อศักย์สามารถได้จากจุดตัดระหว่าง กราฟ tan qa, -cot qa และ k/q ที่ก่า qa ต่าง ๆ เมื่อทราบก่า k/q และ qa จากจุดตัดกราฟจะสามารถหาก่าระดับพลังงานได้จากสมการ

$$E = \frac{\eta^2}{2m_e^*} (qa)^2 - V \qquad ..... (7)$$

จากรูปที่ 5 จะได้ค่า qa ที่จุดตัดของกราฟของสมการ (3) และ (4) ทั้งหมด 3 ค่ากือ 1.33, 2.66 และ 3.95 ตามลำดับ และค่า qa ทั้งสามค่านี้ให้ค่า ระดับพลังงานย่อยที่สอดกล้องกือ  $E_{e1} = -0.486 \text{ eV}, E_{e2} = -0.404 \text{ eV}$ และ  $E_{e3} = -0.271 \text{ eV}$  ตามลำดับ

สำหรับแถบวาเลนต์มีลักษณะของกำแพงศักย์แบบจำกัด 1 มิติ (One Dimensional Quantum Barrier) สำหรับโฮล จึงทำให้แถบพลังงานใน แถบวาเลนต์มีลักษณะต่อเนื่องตลอดภายในแถบวาเลนต์ ดังนั้นเมื่อ กระตุ้นด้วยแสง จะทำให้อิเล็กตรอนสามารถทะลุ (tunneling) จากบริเวณ สูงสุดของแถบวาเลนต์ไปยังแถบพลังงานย่อยทั้งสามแถบในแถบการนำ ทำให้เกิดสเปกตรัม Photocurrent ที่สอดคล้องกับพลังงานที่เกิดจากการ เปลี่ยนระดับพลังงาน interband Transition Energy (E<sub>T</sub>)

้ ค่าพลังงานที่สอคคล้องกับระคับพลังงานย่อยต่างๆ มีก่าคังนี้

$$E_{T1} = 0.863 \text{ eV}$$
  
 $E_{T2} = 0.945 \text{ eV}$   
 $E_{T3} = 1.079 \text{ eV}$ 

ค่าที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นี้สอดคล้องเป็นอย่างดีกับค่า สเปกตรัมที่ (5), (4) และ (3) ของสัญญาณ Photocurrent ตามลำคับ

#### สรุปผล

ค่าเปลี่ยนระดับพลังงานย่อยและค่า พลังงานต้องห้ามของ ErP ของสาร กึ่งตัวนำ Er  $\delta$ -doped InP ตรวจพบโดยวิธีการ Photocurrent Spectroscopy ในการคำนวณเพื่อจะหาก่าที่สอดกล้องกับก่าที่ได้จากการ ทดลอง ใช้แบบจำลองของ Type-II Finite square Quantum Well ระหว่าง InP และ ErP พบว่าก่าที่ได้จากแบบจำลองและการทดลองสอด กล้องกันที่ก่า Band offset หรืออัตราส่วนระหว่าง  $\Delta E_c / \Delta E_v = 56/44$ ซึ่งเป็นช่วงที่ขอมรับได้

ແລະ

Vol. III, No.11, July-October 2001 10

Technical Journal



รูปที่ 5 แสดงกราฟของ tan qa, -cot qa และ k/q ที่ค่า qa ต่าง ๆ

#### กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ขอบคุณ Prof. Dr. Y. Takada และนักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการที่ภาควิชา Material Science and Engineering, Nagoya University ที่อนุเคราะห์ตัวอย่างสารกึ่งตัวนำที่ใช้ ในการวิเคราะห์

## เอกสารอ้างอิง

- L. Bolotov, T. Tsuchiya, A. Nakamura, T. Ito, T. Fujiwara, Y. Takada, Phys. Rev. B, Condensed Matter. Vol 59, No. 19, pp. 12236-9, (1999)
- [2] Y. Takada, K. Fujita, M. Matsubara, N. Yamada, S. Ichiki, M. Tabuchi and Y. Fujiwara, J. Appl. Phys. 82(2),pp. 635-638, 15 July 1997
- K. Fujita, J. Tsuchiya, S. Ichiki, H. Hamamatsu, N. matsumoto,
  M. Tabushi, Y. Fujiwara, and Y. Takeda, Appl. Suf. Sci., 117/118,pp. 758-789, (1997)
- [4] Doyeol, Phys. Rev. B, Condensed Matter. Vol 48, No. 11, pp. 781-4, (1993)
- [5] A.G. Petukhov, W.R.L.Lambrecht, and B.Segall, Phys.Rev.B, 53, 4324 (1996)

[6] Y.K. Su, R.L.Wang, and H.H.Tsai, IEEE Transactionson Electron Devices, Vol. 40, NO. 12, 1993



วิษณู เพชรภา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบ การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ จาก University of Central Florida ประเทศสหรัฐ อเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาค

วิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านฟิสิกส์ ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง



จิตติ หนูแก้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา ฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา พ.ศ. 2526 จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2532 และจบ ปริญญาเอกสาขา Material Sciences and

Engineering จากมหาวิทยาลัยนาโกยา พ.ศ. 2541 ปัจจุบันคำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาคกระบัง หัวข้องานวิจัยที่สนใจได้แก่ Quantum Well Device, Semiconductor Physics และ Optical Instrumentation.